

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

T. Yoshitake et al.
#3
Priority
11/7/01
Q 66996
1/24/02
10fl

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 8月 2日

出願番号

Application Number:

特願2001-235128

出願人

Applicant(s):

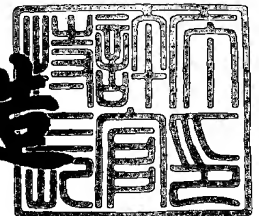
日本電気株式会社

Jc857 U.S. PTO
09/985995
11/07/01

2001年 9月 5日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3082112

【書類名】 特許願

【整理番号】 34103593

【提出日】 平成13年 8月 2日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01J 5/02

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

 【氏名】 吉武 務

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

 【氏名】 今井 英人

【特許出願人】

 【識別番号】 000004237

 【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100064621

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山川 政樹

 【電話番号】 03-3580-0961

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 006194

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9718363

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ボロメータ用酸化物薄膜とその製造方法及び赤外線センサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 赤外線入射に伴う温度変化に対応して抵抗値が変化するボロメータ用酸化物薄膜であって、

$YBaCo_2O_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) で示されるコバルト系酸化物からなることを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜。

【請求項 2】 請求項 1 記載のボロメータ用酸化物薄膜において、

前記コバルト系酸化物における Y 元素の少なくとも一部が、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho のうち少なくとも一種の元素又は化合物で置換されることを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 記載のボロメータ用酸化物薄膜において、

前記コバルト系酸化物における Ba 元素の少なくとも一部が、Sr、Ca のうち少なくとも一種の元素又は化合物で置換されることを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜。

【請求項 4】 請求項 1 - 3 の何れかに記載のボロメータ用酸化物薄膜において、

前記コバルト系酸化物は絶縁性基板の上に形成され、この絶縁性基板はペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜からなることを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜。

【請求項 5】 請求項 1 - 3 の何れかに記載のボロメータ用酸化物薄膜をゾルゲル法により絶縁性基板上に形成することを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜の製造方法。

【請求項 6】 請求項 1 - 3 の何れかに記載のボロメータ用酸化物薄膜を物理的成膜法により絶縁性基板上に形成することを特徴とするボロメータ用酸化物薄膜の製造方法。

【請求項 7】 金属有機化合物を溶媒に溶解させた溶液を絶縁性基板上に塗布し、乾燥後の前記溶液にレーザー光を照射して結晶化させることにより、請求項 1 - 3 の何れかに記載のボロメータ用酸化物薄膜を形成することを特徴とする

ボロメータ用酸化物薄膜の製造方法。

【請求項 8】 請求項 1 - 4 の何れかに記載のボロメータ用酸化物薄膜をボロメータ用抵抗体として用いることを特徴とする赤外線センサ。

【請求項 9】 請求項 8 記載の赤外線センサにおいて、
前記ボロメータ用酸化物薄膜を半導体基板から熱的に分離したマイクロブリッジ構造を有することを特徴とする赤外線センサ。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ボロメータ用酸化物薄膜に係り、特に電気抵抗の温度係数を大きくすることができるボロメータ用酸化物薄膜とその製造方法、ボロメータ用酸化物薄膜を用いた非冷却型の赤外線センサに関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来より、入射赤外線を受光部で吸収して温度変化を引き起こさせ、温度変化によって発生する電気抵抗値の変化を検知することによって入射赤外線の放射強度を検出するボロメータ式の非冷却型赤外線センサが知られている。ボロメータは、基板材料から熱的に隔絶された金属あるいは半導体薄膜の電気抵抗の温度変化を利用するものである。このボロメータ用材料に要求される特性としては、電気抵抗の温度係数（以下、TCRとする）および電気抵抗値などがある。一般にボロメータ用材料の電気抵抗値が大きくなると、ジョンソンノイズが大きくなるため好ましくない。一方、電気抵抗値が小さくなると、ボロメータ以外の配線抵抗とボロメータ用材料の電気抵抗値との差が小さくなるためにやはり好ましくない。このため、ボロメータ用材料の電気抵抗値は室温において $5 \sim 100 \text{ k}\Omega$ 程度であることが望ましい。いいかえるとボロメータ用抵抗体薄膜の厚さを $50 \sim 1000 \text{ nm}$ とすると、ボロメータ用材料に求められる電気抵抗率は $0.025 \sim 10 \Omega \text{ cm}$ 程度が望ましいといえる。

【 0 0 0 3 】

次に、赤外線センサの温度分解能（以下、NETDとする）は、ボロメータ用

材料のTCRの絶対値に反比例する。したがって、TCRの絶対値の大きいボロメータ用材料を用いることによってNETDの小さい赤外線センサを得ることができる。一般にニッケル鉄合金等の合金薄膜はTCRが0.5%/K程度と小さいため、高感度の赤外線センサ用ボロメータ材料としては好ましくない。一方、例えば特開平11-271145号公報にみられるように、酸化バナジウム薄膜はTCRが2%/K程度と比較的大きいため、ボロメータ用材料として利用されている。そして、特開2000-143243号公報にみられるようにバナジウムVの一部をマンガンMn等他の元素で置換する試みも行われており、TCRの絶対値を4%/K程度まで向上できることが報告されている。

【0004】

また、例えば特開2000-95522号公報にみられるように、 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ 等のペロブスカイト型Mn酸化物が磁氣的性質の変化に伴って高温の高抵抗半導体状態から低温の低抵抗金属状態に相転移するユニークな特性を利用することも検討されている。この相転移が起こる温度は、例えばSr組成xを調整することによって室温付近に設定することができる。そして、この相転移に伴い大きな電気抵抗の変化がおこるので、大きなTCRを得ることができる。実際に、この材料では5%/K以上、中には10%/K程度の高いTCRが得られることが報告されており、赤外線センサへの応用が期待されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

前記のごとく酸化バナジウム系薄膜では、元素置換等の改良を行うことにより、2-4%/K程度のTCRを得ることができる。また、ペロブスカイト型Mn酸化物の相転移を利用すれば、5-10%/K程度の比較的大きなTCRが得られる。したがって、従来の非冷却型赤外線センサでは、これらの材料をボロメータ用抵抗体薄膜に利用することが検討されてきた。しかしながら、今後赤外線センサをさらに高感度化及び多画素化していくためには、よりTCRの大きなボロメータ用材料の開発が必要とされている。

本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、電気抵抗の温度係数を大きくすることができるボロメータ用酸化物薄膜とその製造方法及び赤外線センサ

を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明のボロメータ用酸化物薄膜は、 $YBaCo_2O_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) で示されるコバルト系酸化物からなるものである。

また、本発明のボロメータ用酸化物薄膜の1構成例は、前記コバルト系酸化物におけるY元素の少なくとも一部が、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Hoのうち少なくとも一種類の元素又は化合物で置換されるものである。

また、本発明のボロメータ用酸化物薄膜の1構成例は、前記コバルト系酸化物におけるBa元素の少なくとも一部が、Sr、Caのうち少なくとも一種類の元素又は化合物で置換されるものである。

また、本発明のボロメータ用酸化物薄膜の1構成例において、前記コバルト系酸化物は絶縁性基板の上に形成され、この絶縁性基板はペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜からなるものである。ペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜としては、 $SrTiO_3$ 、 $LaAlO_3$ 、 $NdGaO_3$ などがある。

【0007】

本発明のボロメータ用酸化物薄膜の製造方法は、前記ボロメータ用酸化物薄膜をゾルゲル法により絶縁性基板上に形成するものである。

また、本発明のボロメータ用酸化物薄膜の製造方法は、前記ボロメータ用酸化物薄膜を物理的成膜法により絶縁性基板上に形成するものである。物理的成膜法としては、スパッタリング法、レーザーアブレーション法などがある。

また、本発明のボロメータ用酸化物薄膜の製造方法は、金属有機化合物を溶媒に溶解させた溶液を絶縁性基板上に塗布し、乾燥後の前記溶液にレーザー光を照射して結晶化させることにより、前記ボロメータ用酸化物薄膜を形成するものである。

【0008】

本発明の赤外線センサは、前記ボロメータ用酸化物薄膜をボロメータ用抵抗体(4)として用いるものである。

また、本発明の赤外線センサは、前記ボロメータ用酸化物薄膜を半導体基板(

1) から熱的に分離したマイクロブリッジ構造を有するものである。

【0009】

【発明の実施の形態】

〔第1の実施の形態〕

以下、本発明の第1の実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態では、赤外線の入射光を吸収することにより温度を変え、その温度変化により電気抵抗値が変化して、入射した赤外線の強度の信号を読み出す方式のボロメータ方式非冷却赤外線センサにおいて、温度変化により電気抵抗値を変えるボロメータ用薄膜材料に、 $\text{YBaCo}_2\text{O}_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) で示されるコバルト系酸化物を用いる。

【0010】

このコバルト系酸化物薄膜は、室温付近で高温側の低抵抗状態から低温の高抵抗状態に転移する。そして、この転移に伴って、電気抵抗率は高温側では数 $\text{m}\Omega\text{cm}$ 程度であるのに対して、低温側では $100\text{m}\Omega\text{cm}$ 程度まで二桁程度も大きく変化する。このため、この転移点付近で大きなTCRを得ることができる。この低抵抗状態から高抵抗状態への転移が起こる温度は、酸素濃度 x や希土類金属 Pr (プラセオジウム)、Nd (ネオジウム)、Sm (サマリウム)、Eu (ユウロピウム)、Gd (ガドリニウム)、Tb (テルビウム)、Dy (ジスプロシウム)、Ho (ホルミウム)、及びアルカリ土類金属 Sr (ストロンチウム)、Ca (カルシウム) の添加量や組み合わせを変えることによって目的とする値に調整することができる。例えば、 $\text{YBaCo}_2\text{O}_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) において、 x を0近辺にすると290K付近に設定することができる。

【0011】

上記コバルト系酸化物をゾルゲル法で薄膜化する場合には、例えば成分金属のオクタン系コート剤などを所望の比率で十分均一に混合させた後、スピンコーターを用いて絶縁体基板上に回転塗布する。絶縁体基板には、格子定数及び熱膨張率が上記コバルト系酸化物に近く、エピタキシャル成長可能な SrTiO_3 、 LaAlO_3 、 NdGaO_3 などのペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜を用いることが好ましい。

【0012】

混合液塗布後の基板を、混合液中の溶媒を除去するために150℃で30分間程度乾燥させた後、500℃程度で30分仮焼する。この回転塗布、乾燥及び仮焼の工程を、目的とする膜厚が得られるまで繰り返す。最後に700-900℃での高温でアニールして薄膜を作製する。なお、通常、上記の SrTiO_3 などのペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜はSiウエハー上に形成されている。

【0013】

また、上記コバルト系酸化物薄膜をスパッタリング法、レーザーアブレーション法などの物理的成膜方法により作製する場合には、上記コバルト系酸化物の焼結体ターゲット等を用いて、このターゲットの成分をスパッタリング、又はレーザーによってアブレーションすることによって蒸発させる。そして、基板となる SrTiO_3 などのペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜を700℃程度に加熱した後、 $10^{-3}-10^{-1}\text{Torr}$ 程度の酸素分圧雰囲気中に制御して、その基板上に蒸着成分を堆積することにより、目的とする結晶構造を有するコバルト系酸化物薄膜を作製することができる。

【0014】

さらにまた、金属有機化合物を溶媒に溶解させて溶液状とし、これを絶縁性基板上に塗布、乾燥させた後に、波長400nm以下のレーザー光を照射して分解し、生成した酸化物を結晶化させることによって目的とする結晶構造を有するコバルト系酸化物薄膜を作製することができる。この場合には、レーザー光照射による光分解反応の効果によって、500℃以下の低温で薄膜を作製できるという特徴がある。

【0015】

以上のようなコバルト系酸化物薄膜をボロメータ用抵抗材料として用いた赤外線センサの構造の一例を図1に示す。この赤外線センサはマイクロブリッジ構造を有している。すなわち、ボロメータ構造を、シリコン基板から空隙によって熱的に分離したダイアフラム構造とし、窒化シリコン等の梁で支える構造としている。

【0016】

図 1 において、1 はシリコン (S i) 等からなる基板、2 は酸化シリコンと S r T i O₃ などのペロブスカイト型酸化物単結晶薄膜との二層構造からなるブリッジ構造体、3 は空隙、4 はボロメータ用抵抗体、5 は配線、6 は保護膜、7 は赤外線吸収膜、8 は赤外線反射膜である。

【 0 0 1 7 】

図 1 のように、一般的にボロメータ型の赤外線センサは、基板 1 からボロメータ用抵抗体 4 が空隙 3 によって隔離されたマイクロブリッジ構造を有している。このため、ボロメータ用抵抗体 4 を基板 1 から熱的に分離させることができる。本実施の形態では、このボロメータ用抵抗体 4 の材料として上記コバルト系酸化物薄膜を用いる。

【 0 0 1 8 】

図 1 の構造をとることによって、赤外線がセルに入射すると、まず赤外線吸収膜 7 で一部が吸収され、透過した赤外線も赤外線反射膜 8 で反射され、結果として入射した赤外線は赤外線吸収膜 7 に完全に吸収されることになる。吸収された赤外線は熱となりダイアフラムを加熱してボロメータ用抵抗体 4 の電気抵抗を変化させる。そして、ボロメータ用抵抗体 4 と基板 1 中に形成された図示しない読み出し回路は、ボロメータ用抵抗体 4 の両端からブリッジ構造体 2 の支持脚を伝って基板 1 まで配設された配線 5 を介して接続される。これにより、ボロメータ用抵抗体 4 の電気抵抗の変化が入射赤外線の強度を表す信号として読み出し回路によって検出される。

【 0 0 1 9 】

[第 2 の実施の形態]

以下、本発明の第 2 の実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態は第 1 の実施の形態のコバルト系酸化物薄膜をより具体的に説明するものである。本実施の形態では、コバルト系酸化物薄膜をゾルゲル溶液を用いて作製した。まず、Y、B a、C o のオクタン系コート剤を所望の比率で均一に混合した混合液をスピncerを用いて絶縁体基板上に塗布する。絶縁体基板には S i 基板上に形成した S r T i O₃ 単結晶薄膜を用いた。スピncerの条件としては、混合液を絶縁体基板上に塗布後、2 0 0 0 r p m で 3 0 秒間回転させた。

【 0 0 2 0 】

混合液塗布後の絶縁体基板を、混合液中の溶媒を除去するために 1 5 0 ℃ で 3 0 分間程度乾燥させた後、さらに有機成分を除去するため 5 0 0 ℃ 程度で 3 0 分仮焼した。この回転塗布、乾燥及び仮焼の工程を 3 回繰り返すことによって、3 0 0 n m 程度の膜厚が得られた。次に、8 0 0 ℃ で空气中でアニールすることによって、目的とするコバルト系酸化物薄膜を作製した。

【 0 0 2 1 】

作製したコバルト系酸化物薄膜の構造を X 線回折法によって評価したところ、c 軸が基板面に垂直に配向したコバルト系酸化物になっていることが確認できた。さらに、基板面内の構造も評価した結果、薄膜の a 軸、b 軸は基板の方位とそろって成長しており、エピタキシャル成長していることがわかった。薄膜の磁気特性を S Q U I D (Superconducting Quantum Interference Device) という磁気センサによって測定したところ、2 9 0 K 付近で高温側の常磁性状態から低温側の強磁性状態に転移を示した。

【 0 0 2 2 】

また、薄膜の電気抵抗の温度変化を四端子法によって高温側から温度を下げながら測定したところ、2 9 5 K 付近で電気抵抗が 2 桁程度急速に増加して、低抵抗状態から高抵抗状態への転移が起こるのが確認された。この転移に伴って 1 5 % / K 程度の大きな T C R が得られた。この値は従来のバナジウム系薄膜での 2 ~ 4 % / K 程度、及び、ペロブスカイト型 M n 系薄膜での 5 ~ 1 0 % / K 程度の T C R と比較して非常に大きな値である。また、この 2 9 5 K 付近での電気抵抗率も高温側で 3 m Ω c m 程度、低温側で 1 0 0 m Ω c m 程度であり、ボロメータ用材料に必要とされる電気抵抗率の範囲に入っている。このように本実施の形態によれば、T C R の大きなコバルト系酸化物薄膜を提供できるので、ボロメータ用抵抗材料として非常に有利であることが分かる。

【 0 0 2 3 】

[第 3 の実施の形態]

以下、本発明の第 3 の実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態では、コバルト系酸化物薄膜をレーザー蒸着法によって作製した。まず、上記コバル

ト系酸化物のYにPrを1%ドーブした焼結体ターゲット等をレーザー蒸着チャンバーにセットする。基板にはSi基板上に形成したLaAlO₃単結晶薄膜を用いた。チャンバーを真空排気後、基板温度を700℃程度に加熱し、 10^{-3} – 10^{-1} Torr程度の酸素分圧中になるまで酸素ガスを導入した。次に、波長248nmのKrFエキシマレーザーを焼結体ターゲットに照射することによってターゲット成分を蒸発させた。その結果、上記LaAlO₃単結晶薄膜上に目的とするコバルト系酸化物薄膜が成長した。薄膜の膜厚は250nmとした。

【0024】

作製したコバルト系酸化物薄膜の構造をX線回折法によって評価したところ、第2の実施の形態の場合と同様にc軸が基板面に垂直に配向し、かつ、基板面内の方位もそろったエピタキシャル成長したコバルト系酸化物薄膜になっていることが確認できた。また、薄膜の電気抵抗の温度変化を四端子法によって高温側から温度を下げながら測定したところ、300K付近で電気抵抗が2桁程度急速に増加して、低抵抗状態から高抵抗状態への転移が起こった。この転移に伴って18%/K程度の大きなTCRが得られた。なお、成膜手法としては上記のレーザー蒸着法のほかにスパッタリング法等他の方法を用いてもさしつかえない。

【0025】

[第4の実施の形態]

以下、本発明の第4の実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態は第1の実施の形態の赤外線センサをより具体的に説明するものである。本実施の形態では、読み出し回路（不図示）が形成された基板1上にWSi等の赤外で反射率が高い金属をスパッタ法で成膜して、赤外線反射膜8とした。

【0026】

この赤外線反射膜8上に多結晶シリコン膜等からなる犠牲層を空隙3の位置に形成した。この犠牲層上にSiNやSiO₂からなる絶縁膜をプラズマCVD法で成膜し、さらに、この絶縁膜上にSrTiO₃薄膜を積層してブリッジ構造体2を形成した。次に、熱伝導率の小さい金属、例えばTi等をブリッジ構造体2上にスパッタ法で形成し、露光、現像及びエッチング工程によりTiを加工して配線5を形成した。

【 0 0 2 7 】

次に、ナフテン酸 Y 溶液、ナフテン酸 B a 溶液、ナフテン酸 C o 溶液の各金属有機化合物溶液を、Y、B a、C o の比率が 1 : 1 : 2 になるようにトルエンに溶解させた溶液を準備した。この溶液をブリッジ構造体 2 上にスピンコートした後、2 0 0 °C で 1 0 分間乾燥させた。続いて、ボロメータ用抵抗体 4 のパターン部分のみ波長 4 0 0 n m 以下のレーザー光が透過する形状のマスクをブリッジ構造体 2 上に形成した。ブリッジ構造体 2 に塗布した溶液に、 $1 0 \text{ m J} / \text{c m}^2$ 、5 0 H z の A r F エキシマレーザー光を 4 0 0 °C の大気中で 3 0 秒間照射し、さらに $5 0 \text{ m J} / \text{c m}^2$ 、1 0 H z の A r F エキシマレーザー光を 4 0 0 °C の大気中で 5 分間照射した。そして、このようなレーザー照射を 5 回繰り返した。

【 0 0 2 8 】

これにより、レーザー光が照射された溶液はコバルト系酸化物に結晶化し、レーザー光の未照射部分は何も変化が起こらずに金属有機化合物のままの状態に残る。レーザー光の照射後、有機溶剤で洗浄すると、未照射部分は溶解して選択的に除去され、ボロメータ用抵抗体 4 の部分のみにコバルト系酸化物薄膜が残る。次に、このようにして形成したボロメータ用抵抗体 4 の上に S i N や S i O₂ からなる絶縁膜をプラズマ C V D 法で成膜して保護膜 6 を形成した。この保護膜 6 上に反応性スパッタ法などにより T i N 等からなる赤外吸収膜 7 を形成した。赤外吸収膜 7 の形成後、ヒドラジン等により犠牲層をウェットエッチングして空隙 3 を形成した。以上の方法により、基板 1 から熱的に分離した構造のダイアフラムを作製した。

【 0 0 2 9 】

作製したセルが赤外線センサとして作動する原理は以下のとおりである。赤外線がセルに入射すると、まず赤外吸収膜 7 で一部が吸収され、透過した赤外線も赤外線反射膜 8 で反射され、結果として入射した赤外線は赤外線吸収膜 7 に完全に吸収されることになる。吸収された赤外線は熱となりダイアフラムを加熱してボロメータ用抵抗体 4 の電気抵抗を変化させる。このようにして作製した赤外線センサの温度分解能 N E T D は、従来の酸化バナジウム系薄膜をボロメータ用抵抗体 4 に用いた赤外線センサと比較して 1 / 4 以下に下げることができた。

【0030】

従来の酸化バナジウム系薄膜等をボロメータ用抵抗体4に用いた場合、セル面積を小さくすると、NETDが大きくなる、すなわち、赤外線センサの温度分解能が悪くなる。これに対して、本発明のようにボロメータ用抵抗体4にコバルト系酸化物薄膜を用いると、TCRが非常に大きいので、NETDを従来レベル以下に保つことができる。このため、赤外線センサの多画素化にも対応することができる。なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。

【0031】

例えば、 $YBaCo_2O_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) のコバルト系酸化物におけるY（イットリウム）元素の少なくとも一部を、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Hoのうち少なくとも一種類の元素又は化合物で置換してもよい。また、 $YBaCo_2O_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) のコバルト系酸化物におけるBa（バリウム）元素の少なくとも一部を、Sr、Caのうち少なくとも一種類の元素又は化合物で置換してもよい。

【0032】

【発明の効果】

本発明によれば、コバルト系酸化物を用いることにより、ボロメータ用酸化物薄膜の電気抵抗の温度係数を大きくすることができる。したがって、本発明のボロメータ用酸化物薄膜をボロメータ用抵抗体として使用すれば、温度分解能の優れた、高感度の非冷却型赤外線センサを実現することができる。その結果、赤外線センサの多画素化にも対応することができる。

【図面の簡単な説明】

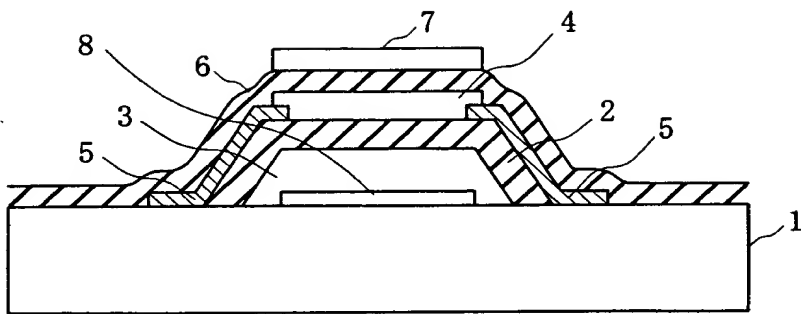
【図1】 本発明の第1の実施の形態においてコバルト系酸化物薄膜をボロメータ用抵抗体4に用いた赤外線センサの一例を示す断面図である。

【符号の説明】

1…基板、2…ブリッジ構造体、3…空隙、4…ボロメータ用抵抗体、5…配線、6…保護膜、7…赤外線吸収膜、8…赤外線反射膜。

【書類名】 図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電気抵抗の温度係数を大きくする。

【解決手段】 ボロメータ用抵抗体材料に、 $\text{YBaCo}_2\text{O}_{5.5+x}$ ($-0.5 < x < 0.05$) で示されるコバルト系酸化物からなる薄膜を用いる。コバルト系酸化物薄膜を用いたマイクロブリッジ構造を有する赤外線センサを提供する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都港区芝五丁目7番1号
氏 名 日本電気株式会社